PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-187702

(43) Date of publication of application: 05.07.2002

(51)Int.CI.

CO1B 3/00 F17C 11/00

H01M 8/00 H01M 8/06

(21)Application number: 2000-388043

(71)Applicant : DENSEI:KK

SEKISUI CHEM CO LTD

ICHIKAWA MASARU

(22)Date of filing:

21.12.2000

(72)Inventor: ICHIKAWA MASARU

SUKAI YASUNORI UTAGAWA TADASHI

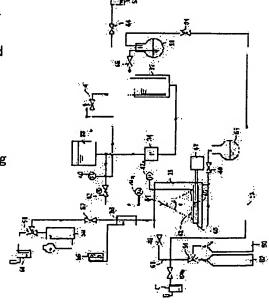
SAKURAMOTO TADASHI

FUKAYA KAZUHIRO TSUCHIYAMA KAZUO

(54) HYDROGEN STORAGE/SUPPLY SYSTEM AND HYDROGEN STORAGE/ SUPPLY APPARATUS (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enhance the reaction efficiency of hydrogen addition reaction or dehydrogenation reaction utilized for the storage or the supply of hydrogen.

SOLUTION: The hydrogen storage/supply apparatus 30 is provided with 1st liquid vessels 31 and 32 each housing a hydrogen storage body or 2nd liquid vessels 31 and 32 each housing a hydrogen supply body, a reaction furnace 35, where the hydrogen addition reaction or the dehydrogenation reaction is performed and a catalyst 42 used for the hydrogen addition reaction or the dehydrogenation reaction is included, a jetting structure part having a jetting nozzle 44 for jetting the hydrogen storage body or the hydrogen supply body to be supplied to the reaction furnace 35 mistily toward the catalyst 42 and a cooling vessel 36 for cooling the hydrogen storage body or the hydrogen supply body generated in the reaction furnace 35.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出關公開發导 特開2002-187702 (P2002-187702A)

(43)公開日 平成14年7月5日(2002.7.5)

(51) Int.CL7		識別記号	F I	ラーマコード(参考)
COIB	3/00		CO1B 3/00	B 3E072
F17C 1	11/00		F 1 7 C 11/00	C 4G040
H01M	8/00		HO1M 8/00	Z 4G140
	8/06		8/08	R 5H027
			東京 化硫 水 经 化	道の数8 〇1. (全 12 頁)

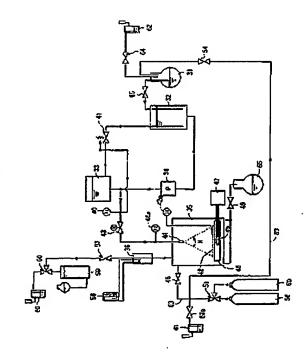
(21)出願番号	特顧2000-389043(P2000-389043)	(71)出廣人 391026106
		株式会社電制
(22)出題日	平成12年12月21日(2000.12.21)	北海道札幌市原別区下野幌テクノバーク1
		丁目2番1号
		(71)出額人 000002174
		積水化学工業株式会社
		大阪府大阪市北区西天湖2丁目4番4号
		(71)出願人 597039939
		市川 勝
	•	北海道札俁市西区八軒3桑西4丁目4-22
		-22
		(74)代理人 100087859
		
		最終質に続く

(54) 【発明の名称】 水菜貯蔵・供給システムおよび水菜貯蔵・供給装置

(57)【要約】

【課題】 水素の貯蔵または供給に利用する水素付加反 応あるいは脱水素反応の反応効率を高めること。

【解決手段】 水素貯蔵体を入れた第一液槽31、32 または水素供給体を入れた第二液槽31,32と、水素 付加反応または脱水素反応を行うと共に、水素付加反応 または脱水素反応に利用する触媒40とを備えた反応炉 35と、反応炉35に供給する水素貯蔵体または水素供 給体を、触媒42に向けて設伏に晒射する晒射ノズル4 4を持つ噴射機構部と、反応炉35で生成した水素貯蔵 体または水素供給体を冷却する冷却槽36とを備えた水 素貯蔵・供給装置30とすること。



₹

33 加圧タンク (噴射機構部の一部)

17

34 ポンプ (噴射機構部の一部)

35 反応炉

36 冷却情

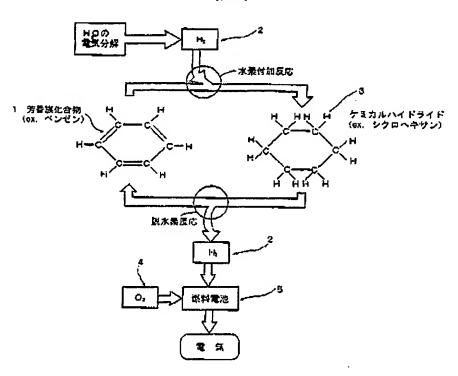
* 4.2 触媒

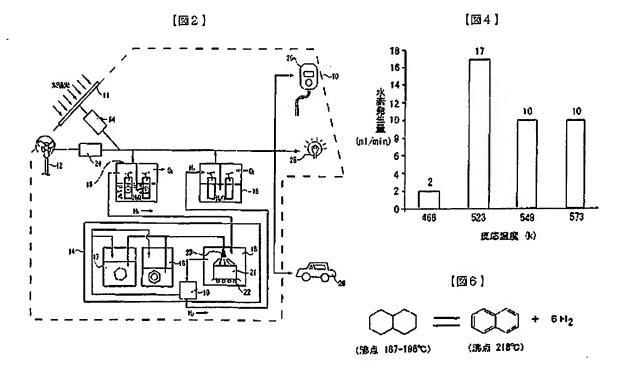
4.4 噴射ノズル (噴射機構部の一部)

45 ヒータ

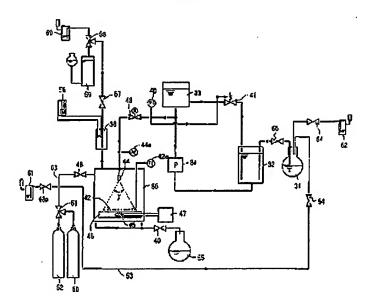
*

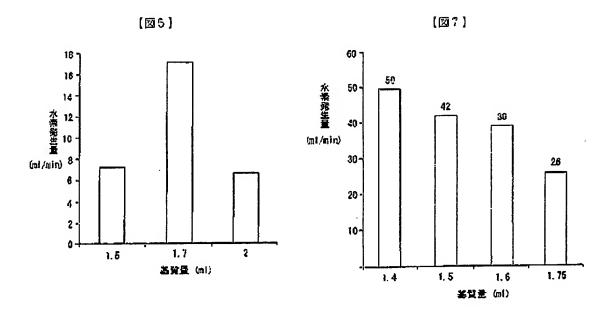
[図1]



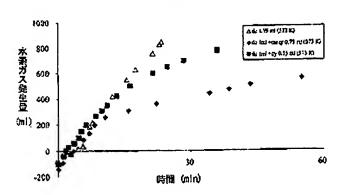


[23]





[図8]



フロントページの続き

(72) 発明者 市川 勝

北海道礼幌市西区八軒3条西4丁目4-22

- 22

(72)発明者 須貝 保徳

北海道礼幌市厚別区下野幌テクノバーク 1

丁目2番1号 株式会社電制内

(72)発明者 歌川 忠

北海道札幌市厚別区下野娘テクノバーク1

丁目2番1号 株式会社電制内

(72)発明者 桜元 正

北海道札幌市厚別区下野幌テクノバーク1

丁目2香1号 株式会社電制内

(72)発明者 深谷 和弘

茨城県つくば市和台32番地 箱水化学工業

株式会社筑波研究所内

(72)発明者 土山 和关

茨城県つくば市和台32番地 箱水化学工業

株式会社筑波研究所内

Fターム(参考) 3E072 EA10

4GG4G AA12 AA42

4G140 AA12 AA42

5H927 AA02 BA13 DD00 DD01

【特許請求の範囲】

【請求項1】水素と反応して、その水素を貯蔵する芳香 族化合物から成る水窯貯蔵体と、水素を放出して上記芳 香族化台物に変化する水素供給体との間における水素付 加反応および脱水素反応を利用して水素の貯蔵および供 給を行う水素貯蔵・供給システムであって、

1

水素付加反応または脱水素反応の内。少なくともいずれ かしつの水素反応に利用する触媒に、上記水素貯蔵体ま たは上記水素供給体を義状に噴射する噴射ノズルを備え た水素反応装置と、

上記水素反応装置内における水素付加反応のために水素 を供給する水素供給装置と、

上記水素反応装置内における脱水素反応によって生成さ れた水素を利用して発電する発電装置と、を償えること を特徴とする水素貯蔵・供給システム。

【請求項2】水素と反応して、その水素を貯蔵する芳香 族化合物から成る水素貯蔵体と、水素を放出して上記芳 香族化合物に変化する水素供給体との間における水素付 加反応および脱水素反応を利用して水素の貯蔵および供 給を行う水素貯蔵・供給システムであって、

上記水業付加反応若しくは上記脱水素反応の内少なくと もいずれか1つの水素反応に利用する触媒を加熱するヒ ータを備えた水素反応装置と、

上記水素反応装置内における水素付加反応のために水素 を供給する水素供給装置と、

上記水素反応装置内における脱水素反応によって生成さ れた水素を利用して発電する発電装置と、を備えること を特徴とする水素貯蔵・供給システム。

【請求項3】前記芳香族化合物を、ベンゼン、トルエ レン、アントラセン、ビフェニル、フェナスレンおよび それらのアルキル置換体の内のいずれかしつまたはいず れかを複数混合したものとすることを特徴とする語求項 1または2記載の水素貯蔵・供給システム。

【請求項4】水素と反応して、その水素を貯蔵する芳香 族化合物から成る水素貯蔵体と、水素を放出して上記芳 香族化合物に変化する水素供給体との間における水素付 加反応または脱水素反応を利用して水素の貯蔵または供 給を行う水素貯蔵・供給装置であって、

上記水素貯蔵体を入れた第一液槽または上記水素供給体 40 を入れた第二波槽の内少なくともいずれか1つの波槽

上記水素付加反応または上記脱水素反応を行うと共に、 上記水素付加反応に利用する触媒とを備えた反応炉と、 上記反応炉に供給する上記水素貯蔵体または上記水素供 給体を、上記触媒に向けて器状に噴射する噴射ノズルを 持つ噴射機模部と、

上記反応炉で生成した上記水窯貯蔵体または上記水窯供 給体を冷却する冷却措と、を偉えることを特徴とする水 **素貯蔵・供給装置。**

【語求項5】前記續射機構部は、前記水素貯蔵体または 前記水素供給体を所定の周期で噴射するパルス噴射を行 うことを特徴とする請求項4記載の水素貯蔵・供給装

【請求項6】前記パルス噴射は、0.5から30秒の範 岡の所定時間間隔で噴射と停止を繰り返すものであるこ とを特徴とする請求項5記載の水素貯蔵・供給装置。

【請求項7】水素と反応して、その水素を貯蔵する芳香 族化合物から成る水素貯蔵体と、水素を放出して上記芳 10 香族化合物に変化する水素供給体との間における水素付 加反応または脱水素反応を利用して水素の貯蔵または供 給を行う水素貯蔵・供給装置であって。

上記水素貯蔵体を入れた第一液槽または上記水素供給体 を入れた第二波槽の内少なくともいずれか1つの波槽

上記波槽から送られた上記水素貯蔵体の水素付加反応ま たは上記水素供給体の脱水素反応の内、少なくともいず れか1つの水素反応を行うと共に、上記水素反応に利用 する触媒とを備えた反応炉と、

20 上記水素付加反応をさせる際に前記触媒を60度から1 20度の範囲の温度に、また、前記脱水素反応をさせる 際に前記触媒を200度から400度の範囲の温度にす るように加熱するヒータと、

上記反応炉で生成した上記水素貯蔵体または上記水素供 給体を冷却する冷却情と、を備えることを特徴とする水 素貯蔵·供給装置。

【請求項8】前記芳香族化合物を、ベンゼン、トルエ ン、キシレン、メシチレン、ナフタレン、メチルナフタ レン、アントラセン、ピフェニル、フェナスレンおよび ン。キシレン。メシチレン。ナフタレン、メチルナフタ 30 それらのアルキル置換体の内のいずれか1つまたはいず れかを複数混合したものとすることを特徴とする語求項 4から7のいずれか1項記載の水素貯蔵・供給装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の肩する技術分野】本発明は、水素を貯蔵し、自 動車あるいは家庭用等の燃料電池に水素を供給する水素 貯蔵・供給システムおよび水素貯蔵・供給装置に関す る.

[0002]

【従来の技術】年々、エネルギーの消費量が増大し、特 に都市部では発電所からの電力供給が追いつかなくなる 等の問題が発生している。現在、日本の電力は、その約 半分を火力発電に、約3割~4割を原子力に、残りを水 力発電や風力発電等に依存している。

【0003】しかし、火力発電の燃料である石油は、化 石燃料であるため、その供給に限りがある。さらに、石 油を燃やした後に発生する二酸化炭素、NOX等の排が スは、地球温暖化をはじめとする地球環境悪化の元凶と なっている。また、原子方は、放射性廃棄物の処理ある 56 いは発電所における字故が問題視されている。

【0004】しかしながら、快適な生活を求め、それを 維持するには、ある程度の環境問題や放射複発生のリス クに目をつぶり、火力発電や原子力発電に窺らざるを得 ないというのが、日本のみならず世界の現状である。な お、水力発電は、季節による電力供給の不安定さ、発電 所建設に伴う森林伐採、発電効率の低さが問題であり、 電力供給方法としては衰退してきている。また、原力発 電や地熱発電は、まだまだコスト的に高いものであり、 小規模に営まっている。

【0005】一方、自動車の燃料に目を向けると、現 在、ガソリン、軽油、プロバンガス等の炭化水素系の燃 料が主として用いられている。最近では、「環境にやさ しい」ことがキャッチフレーズになってきており、排ガ スをできるだけ抑えるべく、電気とガソリンの両方で切 換走行できるハイブリッド自動車が実用化されている。 しかし、ハイブリッド自動車の場合でも、依然としてガ ソリン等の炭化水素燃料を使用せざるを得ない。

【0006】このような発電や自動車開発の現状から、 最近、水素燃料が注目されてきている。水素は、水の管 気分解により生成できる。このため、海水や河川の水を 20 電気分解することを考えれば、水素燃料は無尽蔵に存在 することになる。また、水素は、燃焼後に二酸化炭素を 発生しないクリーンなエネルギー源である。このような 長所から、水素は、ガソリン、石油のような炭化水素熱 料の代替燃料として注目されている。

【0007】しかし、水素は鴬温で気体であるため、液 体や固体に比べて、貯蔵や道鎖が難しい。しかも、水素 は可燃性物質であり、空気と所定の混合比になると、ち ょっとした電気火花の存在下でも爆発してしまう。この る。水素を気体の状態で高圧ボンベに貯蔵することも可 能であるが、貯蔵置が限られると共に高圧封入にコスト がかかる。

【0008】とのような問題を解決する技術に、特勝平 7-192746号公報に開示されるように、水素吸蔵 台金に水素を反応させて貯蔵する方法が知られている。 しかし、La-Ni系、Ti-Fe系等の水素吸蔵台金 は重く、可能式の水素貯蔵装置としては問題がある。ま た。既存の水素吸蔵台金は、吸蔵できる水素量が多くて たいとの要求もある。さらに、水素吸蔵合金が高価であ ることも問題である。

【①①09】そこで、安全性、運搬性、貯蔵能力、低コ スト化にすぐれた水素貯蔵方法として、ベンゼンやナフ タレンのような炭化水素が注目されている。これらの炭 化水素は、遥操性に優れているという長所を有してい

【0010】ベンゼンとヘキサンは同じ炭素数を有する 環状炭化水素であるが、ベンゼンは炭素同士の結合が二 重結合である不飽和炭化水素であるのに対し、シクロヘ 50 の貯蔵および供給を行う水素貯蔵・供給システムであっ

キサンは二重結合を待たない飽和炭化水素である。ベン ゼンの水素付加反応によりシクロヘキサンが得られ、シ クロヘキサンの脱水素反応によりベンゼンが得られる。 また。ナフタレンの水素付加反応によりデカリンが得ら れ、デカリンの脱水素反応によりナフタレンが得られ る。すなわち、これらの炭化水素の水素付加・脱水素反 応を利用することにより、水素の貯蔵および供給が可能 となるのである。

[0011]

10 【発明が解決しようとする課題】しかし、ベンゼンとシ クロヘキサンとの反応に代表される水素付加反応あるい は脱水素反応とを利用して、水素の貯蔵または供給を実 用化するには、さらに反応効率を高める必要がある。特 に、ベンゼンあるいはシクロヘキサンといった液体原料 と触媒との作用が問題となっている。

【0012】本発明は、以上の享情に鑑みてなされたも のであり、水素の貯蔵あるいは供給に必要な原料の反応 性を高めることを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた め、本発明は、水素と反応して、その水素を貯蔵する芳 香族化合物から成る水素貯蔵体と、水素を放出して上記 芳香族化台物に変化する水素供給体との間における水素 付加反応および脱水素反応を利用して水素の貯蔵および 供給を行う水素貯蔵・供給システムであって、水素付加 反応または脱水素反応の内。 少なくともいずれか 1 つの 水素反応に利用する触媒に、水素貯蔵体または水素供給 体を露状に噴射する噴射ノズルを備えた水素反応装置。 と、水素反応装置内における水素付加反応のために水素 ため、水素は、取り扱いに極めて注意を要する燃料であ、30 を供給する水素供給装置と、水素反応装置内における脱 水素反応によって生成された水素を利用して発電する発 電装置とを備えた水素貯蔵・供給システムとするように している。

【りり14】とのため、水素反応装置内において、水素 貯蔵体または水素供給体(以後、原料という)が均一か. つ酒度な畳の液膜状態で触媒表面を覆うこととなり、水 素の貯蔵あるいは供給効率が極めて高くなる。この結 果、天然ガスや石油を精製・改質する際に発生する水素 を効率よく貯蔵できる。また、水素反応装置から排出さ も約3重置%に過ぎず、貯蔵する水素量をもっと多くし 40 れる水素を燃料電池に導き、家庭用あるいは病院用の自 家発電に使用したり、発電所からの電力供給の変動に応 じて補助的に使用することができる。さらに、水素貯蔵 体に外部からの水素を付加して水素供給体を製造するこ ともできる。したがって、家庭や工場において、自立し たエネルギー変換システムを模築できる。

> 【0015】また、別の発明は、水素と反応して、その 水素を貯蔵する芳香族化合物から成る水素貯蔵体と、水 素を放出して芳香族化合物に変化する水素供給体との間 における水素付加反応および脱水素反応を利用して水素

て、水素付加反応若しくは脱水素反応の内少なくともい ずれか1つの水素反応に利用する触媒を加熱するヒータ を備えた水素反応装置と、水素反応装置内における水素 付加反応のために水素を供給する水素供給装置と、水素 反応装置内における脱水素反応によって生成された水素 を利用して発電する発電装置とを備えた水素貯蔵・供給 システムとするようにしている。

【0016】とのため、水素反応装置内において、触媒 の温度低下により、原料と触媒との反応率が低下する危 険性がなくなり、水素の貯蔵あるいは供給効率が極めて 10 高くなる。この結果、天然ガスや石油を精製・改賀する 際に発生する水素を効率よく貯蔵できる。また、排出さ れる水素を家庭用あるいは病院用の自家発電に使用した り、発電所からの電力供給の変動に応じて領助的に使用 したりすることができる。さらに、水素貯蔵体に外部か ちの水素を付加して水素供給体を製造することもでき る。したがって、家庭や工場において、自立したエネル ギー変換システムを模築できる。

【0017】また、別の発明は、上述の発明における芳 香族化合物を、ベンゼン、トルエン、キシレン、メシチ 20 の貯蔵または供給を行う水素貯蔵・供給装置であって、 レン、ナフタレン、メチルナフタレン、アントラセン、 ビフェニル、フェナスレンおよびそれらのアルキル置換 体の内のいずれかしつまたはいずれかを複数混合したも のとした水素貯蔵・供給システムとするようにしてい

【()()18】とれらの原料は、炭素同士の二重結合に水 素が付加することにより、水素を貯蔵する。水素付加後 の水素供給体は、水素を放して元の水素貯蔵体に戻る。 すなわち、上述の原料は、水素のリサイクルに適した原 料である。一方、上述の原料の水素付加反応に際して利 30 用される触媒は、すでに研究開発されて類知されてい る。このため、上述の原料を用いると、寒用化の上で開 発コストを抑えることができる。

【0019】また、別の発明は、水素と反応して、その 水素を貯蔵する芳香族化合物から成る水素貯蔵体と、水 素を放出して芳香族化合物に変化する水素供給体との間 における水素付加反応および脱水素反応を利用して水素 の貯蔵および供給を行う水素貯蔵・供給装置であって、 水素貯蔵体を入れた第一波槽または水素供給体を入れた 第二液槽の内少なくといずれか1つの液槽と、水素付加 40 反応または脱水素反応を行うと共に、水素付加反応に利 用する触媒とを備えた反応炉と、反応炉に供給する水素 貯蔵体または水素供給体を、触媒に向けて毎状に噴射す る暗射ノズルを持つ噴射機構部と、反応炉で生成した水 **素貯蔵体または水素供給体を冷却する冷却槽とを備えた** 水素貯蔵・供給装置とするようにしている。

[0020]とのため、原斜が均一かつ適度な液膜の状 **庶で触媒表面を覆うこととなり、水素の貯蔵あるいは供** 給効率が極めて高くなる。したがって、石油精製プラン トのような水素供給装置。燃料電池を用いた家庭用自家 56 料である。一方、上述の原料の水素付加反応に除して利

発電等の発電装置とを含めたシステムに導入できる。

【①021】また、別の発明は、上述の発明における順 射機構部を、水素貯蔵体または水素供給体を所定の周期 で噴射するパルス噴射を行うものとした水素貯蔵・供給 装置としている。このため、原料が触媒の表面により均 一かつ適度な液膜を形成する状況をつくりやすい。連続 噴射では、供給量が多すぎて触媒表面からこぼれ落ちた り、逆に供給量が少なすぎて水素発生量または水素貯蔵 置が抑制されやすいからである。

【0022】また、別の発明は、上述の発明におけるパ ルス噴射を、()、5から3()秒の範囲の所定時間間隔で 噴射と停止を繰り返すものとした水素貯蔵・供給装置と している。このため、触媒表面に最適な液膜を形成する ことができる。したがって、水素発生量または水素貯蔵 置をより多くすることができる。

【0023】また、別の発明は、水素と反応して、その 水素を貯蔵する芳香族化合物から成る水素貯蔵体と、水 素を放出して芳香族化合物に変化する水素供給体との間 における水素付加反応または脱水素反応を利用して水素 水素貯蔵体を入れた第一液槽または水素供給体を入れた 第二液桔の内少なくともいずれか1つの液桔と、液桔か ら送られた水素貯蔵体の水素付加反応または水素供給体 の脱水素反応の内、少なくともいずれか1つの水素反応 を行うと共に、水素反応に利用する触媒とを備えた反応 炉と、水素付加反応をさせる際に触媒を60度から12 ()度の範囲の温度に、また、脱水素反応をさせる際に触 娘を200度から400度の範囲の温度にするように加 熱するヒータと、反応炉で生成した水素貯蔵体または水 素供給体を冷却する冷却糟とを償えた水素貯蔵・供給装 置としている。

【①①24】とのため、水素反応装置内において、触媒 の温度低下により、原料と触媒との反応率が低下する危 険性がなくなり、水素の貯蔵あるいは供給効率が極めて 高くなる。この結果、天然ガスや石油を精製・改賀する 際に発生する水素を効率よく貯蔵できる。特に、水素貯 蔵体としてベンゼンを用いた場合に、最適の水素貯蔵が 可能となると共に、水素供給体にシクロヘキサンを用い た場合にも最適の水素供給が可能となる。

【0025】また、別の発明は、上述の発明における芳 香族化合物を、ベンゼン、トルエン、キシレン、メシチ レン、ナフタレン、メチルナフタレン、アントラセン、 ピフェニル、フェナスレンおよびそれらのアルキル置換 体の内のいずれかしつまたはいずれかを複数混合したも のとした水素貯蔵・供給装置とするようにしている。

【①①26】とれるの原斜は、炭素同士の二重結合に水 素が付加することにより、水素を貯蔵する。水素付加後 の水素供給体は、水素を放して元の水素貯蔵体に戻る。 すなわち、上述の原料は、水素のリサイクルに適した原

7

用される無媒は、すでに研究開発されて約知されてい る。このため、上述の原料を用いると、実用化の上で開 発コストを抑えることができる。

[0027]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る水素貯蔵・供 給システムおよび水素貯蔵・供給装置の各実施の形態に ついて、図面に基づいて説明する。

【0028】図1は、芳香族化合物の水素化反応と、そ の芳香族化合物の水素化反応により生成した化合物(以) 用して水素を貯蔵あるいは供給する原理を示す図であ

【0029】ベンゼン等の芳香族化合物1は、水の電気 分解等により生成した水素2と水素化反応をして、シク ロヘキサン等のケミカルハイドライド3となる。具体的 には、芳香族化合物1の炭素間の二重結合に水素2が付 加する。ずなわち、水素2は、ケミカルハイドライド3 の形で貯蔵されることになる。

【0030】また、ケミカルハイドライド3は、脱水素 素2は、酸素4と共に燃料電池5内に供給される。燃料 電池5は、水の電気分解と逆の原理で、電気をつくる。 【0031】とのように、芳香族化合物1は、水素を貯 蔵できる水素貯蔵体として機能し、ケミカルハイドライ ド3は水素を外部に供給する水素供給体として機能す る。このため、芳香族化合物1とケミカルハイドライド 3とのサイクルを利用した水素貯蔵・供給システムが形 成できる。

【0032】次に、図1に示した原理を利用した水素貯 蔵・供給システムの一例について説明する。なお、以 後、ケミカルハイドライド等の原料に、香号を付さな

【10033】図2は、エネルギー自立型の家庭用自家発 **鶯を倒とした水素貯蔵・供給システムを模式的に示す図** である。 家屋 10 に設けた水素貯蔵・供給システムは、 主に、屋根等に設置した太陽電池11と、風力発電機1 2と、電解装置13と、水素反応装置14と、燃料電池 15とを借えている。

【0034】水素反応装置14は、ベンゼンに代表され しての水素貯蔵体容器16と、シクロヘキサンに代表さ れるケミカルハイドライドからなる水素供給体を入れた 第二液槽としての水素供給体容器17と、反応炉18 と、冷却器19とを償えている。

【0035】反応炉18には、水素付加反応および脱水 素反応に必要な触媒21が設置されている。また、触媒 21には、これを加熱するためのヒータ22が設置され ている。さらに、反応炉18には、水素貯蔵体または水 素供給体という液体原料を噴射する噴射ノズル23が設 置されている。

【0036】太陽電池11または風力発電機12により つくられた電気は、インバータ24を経由して交流に変 換される。変換された電気は、家庭用の電気機器25に 使用されるか、電気機器25を使用していないときに は、変換された電気は、電解装置13に供給される。電 解装置13では、水の電気分解により水素(H2)と酸 素(02)が発生する。発生した水素は、水素反応装置 14の反応炉18に供給される。

【0037】太陽電池11または風力発電機12により 後。ケミカルハイドライドという)の脱水素反応とを利。10。つくられた電気が過剰な場合、すなわち、家庭用の電気 機器25によって使用される電気以上の発電がなされて いる場合にも、余分な電気は、電解装置13に送られ る。そして、電解装置13で発生した水素は、反応炉1 8に送られる。一方、水素貯蔵体容器16内にあるベン ゼンに代表される水素貯蔵体は、噴射ノズル23によっ て、反応炉18内の触媒21に噴射される。

【10038】すると、水素貯蔵体に水素が付加して、シ クロヘキサンに代表される水素供給体に変化する。ここ で、触媒21は、ヒータ22によって60~120℃に 反応により、芳香族化台物 1 と水素 2 となる。一方、水 20 加熱されている。この結果、水素付加反応による水素供 給体の生成率は非常に高くなる。

> 【0039】反応炉18内で生成された水素供給体は、 冷却器19により液化されて、水素供給体容器17に送 られる。一方、水素付加反応の際に余分な水素は、燃料 電池15へと送られる。

【0040】また、太陽電池11または風力発電機12 によりつくられた電気では、電気機器25の電力をまか なえない場合には、水素供給体容器 1.7内の水素供給体 は、噴射機構を構成する噴射ノズル23によって、反応 30 炉18内の触媒21に噴射される。

【0041】すると、水素供給体の脱水素反応がおき て、ベンゼンのような水素貯蔵体と水素が生成する。と こで、触媒21は、ヒータ22によって220~400 Cに加熱されている。このため、かかる脱水素反応によ る水素貯蔵体の生成率は非常に高くなる。なお、脱水素 反応の効率を考慮すると、触媒21が250~300℃ となるように、ヒータ22を加熱するのがより好まし

【①①42】反応炉18内で生成した水素貯蔵体は、冷 る芳香槟化台物からなる水素貯蔵体を入れた第一液楮と 40 却器19により液化されて、水素貯蔵体容器16に送ら れる。一方、脱水素反応により生成した水素は、燃料電 池15へと送られる。

> 【0043】燃料電池15では、水素反応装置14から 送られてくる水素と、空気中から供給される酸素との反 応により電気がつくられる。こうしてつくられた電気 は、家庭用の電気機器25用に使用される他、電気自動 車26の動力に供給される。このように、水素反応装置 14は、家庭の電力の需要に応じて、シクロヘキサンの ような水素供給体の形でエネルギーを保存したり、水素 50 供給体から脱水素反応によりエネルギーを作り出す。

【①①4.4】なお、図2の水素貯蔵・供給システムにお いて、水素貯蔵体に、ベンゼンではなく、トルエン、キ シレン、メシチレン、ナフタレン、メチルナフタレン、 アントラセン、ピフェニル、フェナスレンおよびそれら のアルキル置換体の内のいずれかしつまたはいずれかを 複数混合を用いても良い。

【①①4.5】次に、本発明の水素貯蔵・供給装置の構造 を、図3に基づいて説明する。

【①①46】図3は、水素の貯蔵と供給のいずれが一方 に示す図である。この水素貯蔵・供給装置30は、主 に、原料供給槽31,32と、加圧タンク33と、ポン プ34と、反応炉35と、冷却桔36とを増えている。 【0047】原料供給槽32は、原料供給槽31のバッ ファの役割を狙っている。原料供給槽31,32には、 同じ種類の原料が入れられており、水素貯蔵体であるべ ンゼンまたは水素供給体であるシクロヘキサンが入れら ns.

【0048】加圧タンク33は、原料供給槽31、32 応炉35に原料を噴射するための圧力をかける構成部で ある。ベンゼンまたはシクロヘキサンは、加圧タンク3 3と原料供給槽32との間に配置したポンプ34によっ て、加圧タンク33に送られる。なお、加圧タンク72 近傍の配管には、圧力計40が取り付けられており、所 定圧力以上になると、それを検知して、加圧タンク33 内の原料を、バルブ41を開いて原料供給槽32に戻す ようにしている。圧力の異常上昇による装置破損を防止 するためである。

キサンを触媒42に噴射させて、水素付加反応または脱 水素反応を起こす機成部である。ベンゼンあるいはシク ロヘキサンの噴射は、バルブ43を開いて、噴射ノズル 44から行うようにしている。原料を噴射ノズル44か ら嘈射することにより、反応炉内の触媒42表面に、原 料の液膜を形成しやすいようにしている。また、反応炉 35には、鮭媒42に接した熱電対に続く温度計428 が設けられている。温度計42aにより、鮭媒42の温 度をみるためである。また、反応炉35に入る配管近傍 aによって、噴射圧を計測できる。

【0050】バルブ43は、その関閉の時間制御によっ て原料の瞬時的な噴射、すなわちパルス噴射を可能とす るバルブである。噴射している時間は、①、5~30秒 の範囲で可変できる。また、噴射を停止している時間 は、()、()~3()秒の範囲で可変できる。但し、通常の 運転の際には、噴射時間は5.0秒が上限となるように 設定されている。

【① 051】噴射ノズル44は、原料の噴射範囲角度X が圧力(0.3MPa時に50度となるように設計されて 50 【0059】冷却格36は、水冷循環式の冷却装置であ

いる。原料の噴射量は、1秒間の連続噴射で5.0~4 (). ()m | の範囲で調整可能となっている。

【りり52】触媒42には、活性炭素地に白金触媒を担 **持させたものが用いられている。鮭媒88の重量は、1** (1) gとしているが、その重量や大きさは限定されな

【0053】また、反応炉35には、触媒42を頒熱す るヒータ45が備えられている。ヒータ45は、触媒4 2を置いているヒータ格納部46に内蔵されている。ヒ を行うことができる水素貯蔵・供給装置の構成を模式的 10 ータ45の通電は、温度調節機47により制御可能であ る。用いる原料等の製造条件の相違により、触媒42の 温度を変更できるようにするためである。

> 【0054】また、ヒータ45は、最高600℃まで加 熱可能であり、100~600℃の範囲で制御可能とな っている。ベンゼンの水素付加反応によりシクロヘキサ ンを生成させる際には、約60~120℃に加熱する。 変換効率を考慮すると、好ましくは、95~105℃に 加熱するのが良い。

【①①55】また、シクロヘキサンの脱水素反応により から響いたペンゼンまたはシクロヘキサンに対して、反 20 ベンゼンを生成させる際には、約220~400°Cに加 熱する。同様に変換効率を考慮すると、好ましくは、2 50~300°Cに加熱するのが良い。水素付加反応は発 熱反応であり、脱水素反応は吸熱反応であるため、後者 の反応には熱エネルギーを必要とするからである。

【①①56】また、反応炉35には、炉内に水素を供給 するためのパルプ48と、反応炉35内の原料を抜くた めのドレインバルブ49が設けられている。バルブ48 は、水素ボンベ50から、水素を反応炉35内に入れる ためのバルブである。また、水素ポンベ50とバルブ4 [0049] 反応炉35は、ベンゼンあるいはシクロヘ 30 8の間には、三方パルブ51が設けられている。この三 方バルブ51は、窒素ポンベ52からの窒素と水素ポン べ5()からの水素とを切り替えるバルブである。

> 【0057】なお、窒素ポンベ52からの窒素は、三方 バルブ51を開にして、配管53とバルブ54とを経由 して、原料供給槽31へと送られる。ベンゼンまたはシ クロヘキサンを反応炉35に送る前に、原料供給系を置 **素雰囲気にするためである。**

【0058】また、ドレインバルブ49は、反応炉35 内の原料を反応物格納槽55に入れるためのバルブであ には、圧力計448が設けられている。この圧力計44 40 る。反応炉35において、水素とベンゼンとの間で水素 付加反応が起きると、シクロヘキサンという反応物が生 成する。また、シクロヘキサンの脱水素付加反応が起き ると、ベンゼンという反応物と水素が生成する。これら の反応物は、反応時には気体であるが、冷却槽36で冷 却されると液化する。液化したシクロヘキサンまたはベ ンゼンは、冷却槽36から反応炉35内に戻ってくる。 そして、ドレインバルブ49を関にすると、液化したシ クロヘキサンまたはベンゼンは、反応炉35から反応物 格納槽55に送られる。

る。冷却桔36は、反応炉35から送られてくるベンゼ ンまたはシクロヘキサンを完全に液化させて、水素と分 離するために設けられている。冷却は10~20℃で行 われ、1℃単位に可変できる。

【0060】冷却椿36で液化したベンゼンまたはシク ロヘキサンは、反応炉35に戻る一方で、未反応の水素 または反応により生成した水素は、バルブ57、三方バ ルブ58を経由して、外部に排気することができる。ま た。三方バルブ58には、発生ガス量計測器59が接続 されており、発生したガスの分析をすることができる。 【0061】また、三方バルブ58より外部側と、水素 ボンベ50 および窒素ボンベ52からバルブ48に達す るまでの間から分岐した先と、原料供給槽31より外部 側に、それぞれバブラー60、61、62が設けられて いる。これちのバブラー60、61、62は、主として 外部からの空気の混入と、内圧上昇時に圧力を逃がす目 的で設けられている。

【0062】ここで、水素貯蔵・供給装置30を用いて ベンゼンの水素付加反応により水素を貯蔵する手順と、 る手順の一例について、図3に基づいて簡単に説明す

【10063】外部からの水素を貯蔵する場合には、ま ず、窒素ボンベ52、三方バルブ51、バルブ54を開 いて、原料供給槽31内部を窒素雰囲気にする。次に、 三方バルブ51を切り替えて、水素ポンペ50、バルブ 48を開いて、反応炉35内に水素を供給する。次に、 反応炉35のヒータ45に通常して、触媒42の温度を 100℃前後に調整する。次に、ボンプ34を運転し て、原料供給槽32内のベンゼンを加圧タンク33内に 30 3Kとした。 供給する。原料供給槽32内のベンゼンが少なくなる と、バルブ65を関いて、原料供給槽31からベンゼン が供給される。

【0064】次に、冷却譜36の冷却水の温度を10℃ に調整する。そして、バルブ43をバルス制御しなが ち、ベンゼンを反応炉35の触媒42に向けてバルス噴 射する。パルス噴射の条件としては、1.0秒の噴射と 1. ()秒の停止を繰り返す方法が最適である。

【0065】反応により生成したシクロヘキサンは、冷 レインバルブ49を関にすると、反応物格納槽55に、 シクロヘキサンが貯まる。一方、糸反応の水素は、冷却 槽36、三方バルブ58、バブラー60を経由して、外 部に移動する。

【0086】一方、水素を外部に供給する場合には、ま ず、窒素ポンベ52、三方パルブ51、パルブ54を関 いて、原料供給槽31内部を塩素雰囲気にする。次に、 三方パルプ51を切り替えて、水素ポンペ50、パルブ 4.8を関いて、反応炉3.5内に水素を供給する。次に、 反応炉35のヒータ45に通常して、触媒42の温度を 50 【0075】図7は、デカリンの脱水素反応の基質置依

調整する。次に、ポンプ34を運転して、原料供給槽3 2内のシクロヘキサンを加圧タンク33内に供給する。 【0067】次に、冷却槽36の冷却水の温度を10℃ に調整する。そして、バルブ43をバルス制御しなが ら、シクロヘキサンを反応炉35の触媒42に向けてパ ルス噴射する。パルス噴射の条件としては、1.0秒の 順射と1. ()砂の停止を繰り返す方法が最適である。

12

【0068】反応により生成したベンゼンは、冷却槽3 6で冷却されて、反応炉35に戻る。そして、ドレイン - 10 バルブ49を開にすると、反応物格納槽55に、ベンゼ ンが貯まる。一方、反応により生成した水素は、冷却槽 36. 三方バルブ58, バブラー60を経由して、外部 に移動する。

【0069】次に、水窯貯蔵・供給装置30の道転前 に、ラボスケールの装置で運転条件を把握した結果につ いて説明する。

【0070】図4は、シクロヘキサンの脱水素反応の反 応温度依存性を調べた結果を示すグラフである。機輔は 反応温度で、緩軸は毎分の水素発生量である。 図4に示 シクロヘキザンの脱水素反応により外部に水素を供給す。20。 すように、反応温度が523K(=250℃)の時に、 水素発生量が最も多いことがわかる。また、反応温度が 高すぎると、水素発生量が減少している。これは、原料 の揮発分が多くなり、触媒42表面での原料の液膜が形 成されにくくなるからであると考えられる。

> 【0071】図5は、シクロヘキサンの脱水素反応の基 質量依存性を調べた結果を示すグラフである。機軸は基 賢量で、縦軸は毎分の水素発生量である。ここで、基質 置とは、シクロヘキサンの供給置のことである。触媒4 2には0.5gの白金を用いた。また、反応温度は52

> 【0072】図5に示すように、シクロヘキサンの供給 置が1.7m1の時に、水素発生量が最も多いことがわ かる。シクロヘキサンの供給置が増えると、水素発生置 が減少するのは、触媒42に必要以上のシクロヘキサン がかかり、触媒42表面に適度な液膜を形成できなかっ たためであると考えられる。

【0073】以上は、シクロヘキサンの脱水素反応条件 を調べるために行った実験結果であるが、シクロヘキサ ン以外にもデカリン等のケミカルハイドライドを使うこ 却糟36で冷却されて、反応炉35に戻る。そして、ド 40 ともできる。次に、デカリンを使ったラボスケールでの 実験結果について説明する。

> 【10074】図6は、デカリンの脱水素反応によりナフ タレンと水素が生成し、逆にナフタレンの水素付加反応 によりデカリンが生成するという可逆反応式を示す図で ある。デカリンを用いた場合にも、シクロヘキサンを用 いた場合と同様に、炭素骨格を喰すことなく、水素のみ を生成できる。したがって、デカリンは、二酸化炭素の 放出に伴う地球温暖化を防止できるクリーンなエネルギ 一憑となり得る。

存性を調べた結果を示すグラフである。構輸は基質量 で、縦軸は毎分の水素発生量である。ここで、毎質量と は、デカリンの供給量のことである。触媒42には0. 5gの白金を用いた。また、反応温度は523Kとし tc.

【0076】図?に示すように、デカリンの供給量が 1. 4から1. 75m!と多くなるにつれて、水素発生 置が少なくなることがわかる。デカリンの供給量が増え ると水素発生量が減少するのは、触媒42に必要以上の きなかったためであると考えられる。

【0077】図8は、ケミカルハイドライドの種類を変 えて水素の発生量を比較した結果を示すグラフである。 図中、白抜きの三角は、デカリンのみを用いた場合を示 す。また、黒の菱形は、デカリンとメチルシクロヘキサギ *ンとの混液を用いた場合を、黒の四角は、デカリンとシ クロヘキサンとの複液を用いた場合を、それぞれ示す。 水素ガスの発生量は、時間毎に累積値で示している。反 応温度は573Kで、原料の供給置は、3種類とも1. 75ml/minとした。

【0078】との結果、デカリンのみを脱水素した場合 には、水素ガスの発生が極めて多くなることがわかっ た。また、デカリンとメチルシクロヘキサンとの混液の 場合には、最も水素ガスの発生量が少ないことがわかっ デカリンがかかり、触媒42表面に適度な液膜を形成で「10」た。なお、デカリンの脱水素反応で生成するナフタレン は、融点(約80℃)が高くて鴬湿では使いづらい。こ のため、デカリンよりも、シクロヘキサンを使用するの が好ましい。

[0079]

【表1】

1	水蛭放出的		水素放出後		燃料	料整盘、容積、反応時要求終量、水泰放出反応形態				
	物質名	化学式	物質名	化学式	水索 W1%	水素5Kg分 燃料型量 Kg	水型5Ke分 磁容体数	水築 要求! KJ/s	丑俗	水穀放出 反体形態
Ì	シクロヘキサン	C _i H _{t2}	ベンゼン	C₀H₄	7,20%	69.5	89.2	33,9	设装	脱水素
ı	メチルシクロヘキサン	C ₇ H _M	トルエン	C ₇ H ₈	6.17%	81.0	105.4	33,A		
	テカリン	CioHia	かかり	CinHa	7.32%	88.3	76.2	30.0		
	メタトージ	СНОН	佐酸メチル	HCCOCH,	6.30%	79.3	100.4	22.8		
Ц	水気化リチウム	LiH	水酸化リチウム	Lioh	7.78%	64.3	68.6	-54.0	発熱	加水分解
	水器化加沙克	Calte	水酸化からかん	Ca(OH)2	5.17%	96.7	72.0	-50.8		

【0080】表1は、各種ケミカルハイドライドを用い た水素放出結果を示す表である。ケミカルハイドライド としては、シクロヘキサンあるいはデカリンの他に、メ チルシクロヘキサンも使用できる。また、その他の水素 を含む化合物として、メタノール、水素化リチウム、水 40 適の原料である。 **遠化カルシウムも使用可能である。水素の発生量(=同** 一重量の原料に対して発生する水素の重量〉だけから判 断すると、水素化リチウム、デカリン、シクロヘキサン が原料として保位性を持っている。

【0081】しかし、水素放出後の原料の使いやすさの 面からいうと、ナフタレンを生成するデカリンは、シク ロヘキサンよりも劣る。ナフタレンは常温で固体とな

- り、80℃以上では液化せずに昇華してしまうからであ る。また、水素化リチウムは、取り扱い上の危険性の面

反応後にペンゼンとなる。ベンゼンは游点80.1℃で あり、ほぼ同じ游点を持つシクロヘキサンと同様に、使 いやすい原料である。したがって、水素放出置と安全を 含めた使用上の容易性の観点から、シクロヘキサンが最

[0082] ただし、安全面での改善、使用条件の変更 を行えば、シクロヘキサン以外の原料も使用できる。例 えば、水素放出後に、キシレン、メシチレン、メチルナ フタレン、アントラセン、ピフェニル、フェナスレンお よびこれらのアルキル環換体の内の少なくともいずれか 1つとなるケミカルハイドライドが使用できる。

【①①83】また、反応に用いる無媒の種類も検討し た。具体的には、白金、4.5 盒置%タングステンを混 ぜた白金、1.9w(%ロジウムを混ぜた白金を検討し で、シクロヘキサンに劣る。シクロヘキサンは、脱水素 50 た。この結果、4.5 重量%タングステンを混ぜた白金 の触媒を用いた時に、水素発生置が最も多くなることが わかった。

15

[0084]

【実施例】次に「下記に示す実施例において、シクロへ キサンを触媒にバルス噴射させる噴射条件を変えた場合 の水素発生量の変化を調べた結果について説明する。

【0085】使用した触媒は、アルミナに0.5重置% の白金を担待させた円筒形の顆粒状のものを用いた。 絵* *媒の量は20gとした。触媒温度は、240~270℃ とした。冷却温度は、13~15℃とした。シクロヘキ サンの噴射時間は、1秒間とし、噴射を停止している噴 射間隔を10秒。20秒および30秒と変化させて、各 噴射間隔と水素発生置との比較を行った。

16

【10086】との結果を表2に示す。

[0087]

【表2】

The same of the sa		実験 競 展	
吸射型网 (sec)	实験時間(min)	水果発生建度(ml/soc)	水素ガス生成効率(別)
iO	17	11.0	81 7
20	82	9. 6	82.3
30	48	12.3	83. 3

【0088】表をに示すように、順射間隔10秒の場合 には、噴射後、17分後の水素発生速度計測値で11. Oml/secであり、実験開始から17分間の累積水 素発生量から割り出した水素ガスの生成効率は、約8 1.7%であった。なお、水煮ガスの生成効率は、理論 上の水素ガス生成量に対する割合(%)をいう。

【()()89】また、噴射間隔2()砂の場合には、噴射 後、82分後の水素発生速度計測値で9.6ml/se cであり、寒験開始から82分間の累積水素発生量から 割り出した水素ガスの生成効率は、約82.3%であっ

【0090】また、噴射間隔30秒の場合には、噴射 後、48分後の水素発生速度計測値で12、3m1/s e c であり、実験関始から48分間の累積水素発生量か **ら割り出した水素ガスの生成効率は、約83.3%であ** った。

【1) 191】水素発生速度は、寒験開始からの時間の経 30 過に伴い低下するため比較できないが、水素ガスの生成 効率で比較すると、当実験における噴射間隔の範囲内で は、噴射間隔に依存せずに、80%以上の高い効率で水 素の生成が認められた。

【0092】なお、本発明は、上述の実施の形態や実施 例に限定されない。以下のような種々変更した実施の形 騰を採用しても良い。**例えば、上述の実施の形態では、** 水素付加反応と脱水素反応の両反応を含むシステムを説 明したが、いずれか一方のみの反応を行う装置やシステ ムを構成し、他方の反応を行う装置やシステムは、別の 40 13 水素供給装置 システムとして構成しても良い。

【①①93】また、燃料電池以外の発電装置を採用して も良い。例えば、水素を燃やして水を沸騰させ、タービ ンを回転させて発電機の回転によって、電気をつくるよ うにしても良い。さらに、従来の火力発電所や原子力発 医所等の電気供給システムと、この水素貯蔵・供給シス テムとを併用しても良い。

[0094]

【発明の効果】本発明によれば、水素付加反応あるいは 脱水素反応の反応効率を高めることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の水素貯蔵・供給システムの根幹をなす 原理を示す図で、芳香族化合物の水素化反応と、その芳 香族化合物の水素化反応により生成した化合物(以後、 ケミカルハイドライドという) の脱水素反応とを利用し て水素を貯蔵あるいは供給する流れを示す図である。

20 【図2】本発明の水素貯蔵・供給システムの実施の形態 を示す図で、エネルギー自立型の家庭用自家発電を例と した水素貯蔵・供給システムを示す図である。

【図3】本発明の水素貯蔵・供給装置の実施の形態を示 す図で、水素の貯蔵または供給を行うことができる水素 貯蔵・供給装置を模式的に示す図である。

【図4】 本発明に用いられるシクロヘキサンの脱水素反 応の反応温度依存性を調べた結果を示すグラフである。

【図5】 本発明に用いられるシクロヘキサンの脱水素反 応の基質量依存性を調べた結果を示すグラフである。

【図6】本発明に使用可能なデカリンの脱水素反応によ りナフタレンと水素が生成し、逆にナフタレンの水素付 加反応によりデカリンが生成する反応式を示す図であ る。

【図7】本発明に使用可能なデカリンの脱水素反応の基 賃量依存性を調べた結果を示す グラフである。

【図8】 本発明に使用可能なケミカルハイドライドの種 類を変えて水素の発生費を比較した結果を示すグラフで ある。

【符号の説明】

- - 14 水素反応装置
 - 15 発電装置
 - 16 水素貯蔵体容器(第一液槽)
 - 17 水素供給体容器(第二液槽)
 - 18 反応炉
 - 21 触媒
 - 22 ヒータ
 - 23 噴射ノズル
 - 30 水素貯蔵・供給装置(水素反応装置)
- 59 31,32 原斜供給槽(第一液槽,第二液槽)